

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成25年12月12日(2013.12.12)

【公開番号】特開2012-104515(P2012-104515A)

【公開日】平成24年5月31日(2012.5.31)

【年通号数】公開・登録公報2012-021

【出願番号】特願2010-248932(P2010-248932)

【国際特許分類】

H 01 S 5/323 (2006.01)

H 01 L 33/32 (2010.01)

H 01 L 33/16 (2010.01)

H 01 L 21/205 (2006.01)

【F I】

H 01 S 5/323 6 1 0

H 01 L 33/00 1 8 6

H 01 L 33/00 1 6 0

H 01 L 21/205

【手続補正書】

【提出日】平成25年10月29日(2013.10.29)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 1 1 1

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 1 1 1】

一方、酸素源が原料以外にあるとき、因子は、炉内の治具、デポ、洗浄剤残渣等の「酸素源」、「酸素源からの酸素脱離係数」、「結晶中への酸素取り込み係数」が考えられる。上記の通り、「結晶中への酸素取り込み係数」は雰囲気ガスによらない。よって残りの「酸素源からの酸素脱離係数」が雰囲気ガスによって変わる。水素は、還元性のガスであり、デポ等の望まれない堆積物から酸素を脱離させる。この酸素がエピタキシャル結晶中に取り込まれるものと考えられる。これ故に、雰囲気ガス(キャリアガス及びサブフローガス)として窒素に用いることが好適である。